

## 플라즈마 디스플레이 패널의 MgO막 부식 특성에 관한 연구

°신재화, 정동효  
인천전문대학

### The Study of erosion characteristics for MgO layer in plasma display panel

Jae-Hwa Shin, Dong-Hyo Jeong  
Incheon City College

**Abstract** - In this paper, we showed the erosion characteristics of MgO protector layer related to lifetime of plasma display panel(PDP). We observed MgO erosion characteristic as a functions of deposition conditions. In RIE condition of Xe gas, the lowest erosion rate appears in the conditions of no heating, bias voltage -30V and pressure 5mtorr. In general, as deposition rate increases, erosion rate decreases.

### 1. 서 론

최근 HD(High Definition) TV와 같은 고화질 대형 평판표시장치나 휴대용 컴퓨터, 통신장비, 옥외광고 등의 여러 분야에서 경량, 박형의 평판디스플레이의 필요성이 급속히 증대되고 있으며 평판디스플레이의 시장형성도 매우 빠른 속도로 신장되고 있다.

평판디스플레이 소자 중 가스방전관을 이용한 자발광 소자인 플라즈마 디스플레이 패널(PDP)은 전극 구조상 전극이 방전가스에 노출되어 동작되는 DC형과 유전체충으로 절연되어 교류로서 동작하는 AC형으로 나눌 수 있다.[1] 1964년 Illinois 대학의 Bitzer와 Slottow에 의해 개발된 AC형 PDP는 DC형 PDP에서 부각된 모든 cell에 전류제한용 고저항을 부가해야 하는 점과 전극이 sputtering에 의해 깎여 수명이 단축되는 단점을 방전용 금속전극 상부에 유전체와 보호층을 균일하게 도포함으로써 개선할 수 있다는 점 때문에 1995년을 기점으로 연구개발이 집중되었다. 현재까지 AC형 PDP에서 사용되고 있는 보호막 물질로는 이온의 충격에 의하여 발생하는 이차전자를 priming 전자로 이용할 수 있을 정도의 높은 이차전자 방출계수를 지니고 있고 낮은 부식 특성을 갖는 MgO가 사용되고 있다.[2]

AC형 PDP는 1997년 일본 전자회사의 42인치 금양산을 필두로 하여 우리나라 전자회사에서 63인치 금이 개발될 정도로 급격한 발전을 해왔다. 그러나 아직 까지 장수명 실현을 위한 MgO막의 erosion에 대한 결과들이 미흡하고, 높은 소비전력, 낮은 효율 등의 문제점이 남아있다.[3-5]

본 논문에서는 AC형 PDP의 장수명과 관련있는 MgO 보호막의 erosion 특성을 MgO막의 증착변수인 온도, 압력, bias에 따라 제작된 시편을 ICP 장비를 이용하여 반응성 이온 식각(RIE) 모드에서 PDP에 사용되는 He, Ne, Xe 가스를 사용하여 각각의 가스에 대한 erosion 특성을 살펴보았다.

### 2. 본 론

#### 2.1 실험 방법

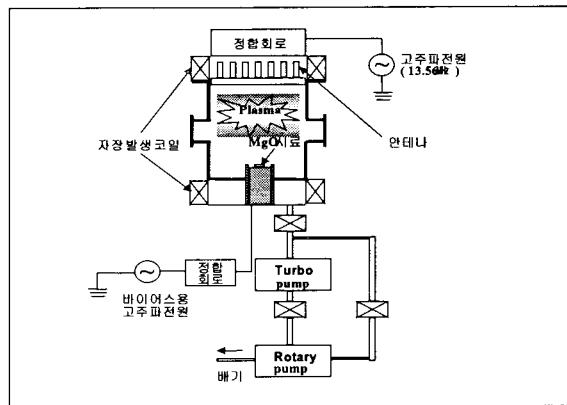


그림 1. 유도 결합형 플라즈마 식각 장치  
Fig.1. Schematic diagram of Inductivity Coupled Plasma Etching System

실험에 사용한 유도 결합형 플라즈마 식각 장치(Inductivity Coupled Plasma Etching System, ICP)의 개략도를 그림 1에 나타냈으며 으며 실제 MgO 막의 erosion 실험에서는 바이어스용 고주파 전원만 사용하여 반응성 이온 식각(RIE) 모드에서 실험하였다.

Magnetron sputtering 방법으로 증착된 MgO 막의 증착 변수와 조건은 표 1에 나타냈다.

표 1. MgO의 증착변수와 증착조건  
Table 1. Deposition parameters and condition of MgO

증착 변수	증착 조건
온도	no heating, 200°C, 300°C, 400°C, 450°C
bias	ground, floating, -10V, -30V, -50V
pressure	5mtorr, 10mtorr, 20mtorr

온도, bias, pressure의 증착 변수에 따라 제작된 MgO막을 ICP 장비에 넣고 PDP에서 사용되고 있는 네온(He), 헬륨(He), 제논(Xe) 가스를 흘리면서 RIE(Reactive Ion Etching) 모드에서 erosion 실험을 하였다. Rotary pump로  $10^{-3}$  torr 까지 pumping 한 후 turbo pump로  $3 \times 10^{-6}$  torr 이하의 초기 진공을 유지시킨 후 mass flow controller를 사용하여 가스 유량을 조절하였다.

## 2.2 실험 결과

He, Ne, Xe 가스 각각에 대해 50mtorr, 자기 바이어스 전위 -400V의 RIE조건에서 60분 동안 erosion 실험을 하였으며, ellipsometer를 사용하여 erosion rate을 분석하였다. 각각의 조건에서 증착된 sample을 한 가스에 대해 동시에 loading하여 erosion 실험을 동일조건에서 수행하였다. 주로 PDP의 수명은 Xe 이온의 충격에 의해 직접적인 영향을 받는 것으로 알려져 있다.[6,7] 따라서 Xe 가스가 erosion에 중요한 역할을 수행하게 된다.

### 2.2.1 온도에 따른 erosion rate 분석

Power 500W, bias -50V, 압력 10mtorr의 magnetron sputter 증착조건에서 no heating, 200°C, 300°C, 400°C의 온도 변화에 따라 증착된 MgO 막의 erosion rate을 그림 2에 나타냈다. deposition rate도 같이 도시하였다. He, Xe 가스에서는 no heating시 erosion rate이 가장 낮았으며 기판 온도가 증가함에 따라 deposition rate은 감소하지만 erosion rate은 증가하는 경향이 나타났다. Ne 가스에서는 기판 온도 300°C에서 증착한 MgO의 erosion rate이 낮게 나타났다.

기판온도가 증가함에 따라 기판에 흡착한 입자의 표면 이동과 재결합이 활발해지기 때문에 결정입자의 크기가 커진다. 그러나, 기판온도가 증가할 때 결정입자는 커지지만 박막의 구조는 치밀하지 못해 MgO 막이 쉽게 erosion 되어진다고 사료된다.

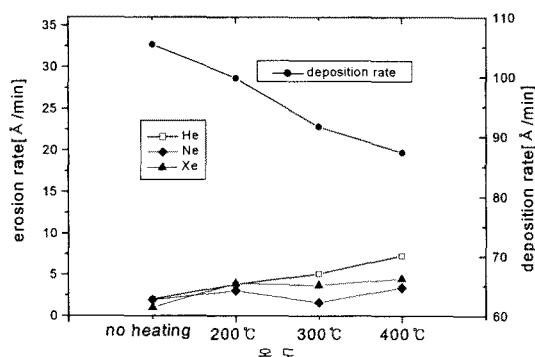


그림 2. 온도에 따른 증착된 MgO의

deposition rate과 erosion rate

Fig. 2. Deposition rate and erosion rate  
of MgO vs. temperatures

### 2.2.2 bias에 따른 erosion rate 분석

압력 10mtorr, 온도 300°C, power 500W의 magnetron sputter 증착조건에서 bias 전압을

ground, floating, -10V, -30V, -50V로 변화시켰을 때 증착된 MgO막으로 실현을 한 결과를 그림 3에 deposition rate과 erosion rate으로 나타냈다.

Ne, Xe 가스에서는 자기 바이어스 전위가 -30V일 때의 erosion rate이 가장 낮았으며 deposition rate이 증가할수록 erosion rate은 감소하는 경향이 나타났다. He 가스에서는 floating시 erosion rate이 낮게 나타났고 자기 바이어스 전압이 증가할수록 erosion rate도 증가하는 것으로 나타났다.

기판의 바이어스 전위가 -10V 이상의 범위에서 바이어스의 크기가 증가함에 따라 증착속도는 약간 증가하다가 높은 바이어스에서는 다소 감소한다. 이것은 낮은 바이어스 영역에서는 바이어스 증가에 따라 기판에 입사하는 입자의 수가 증가하여 증착속도가 증가하지만 높은 바이어스 영역에서는 이러한 입자의 수가 증가하는 것보다 가속된 이온에 의해 증착된 MgO 박막에서 재스퍼터링되는 입자가 많기 때문이다. -10V와 -50V의 막구조가 no bias일 때 보다 치밀하지 못하게 나타났다.

따라서 -10V와 -50V일 때의 erosion rate도 증가하는 것으로 사료된다.

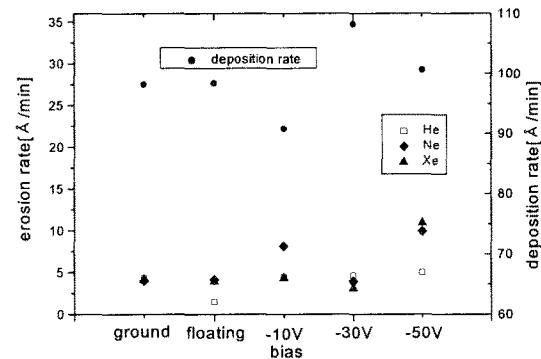


그림 3. bias 전위에 따른 증착된 MgO의 deposition rate과 erosion rate

Fig. 3. Deposition rate and erosion rate  
of MgO vs. bias voltage

### 2.2.3 압력에 따른 erosion rate 분석

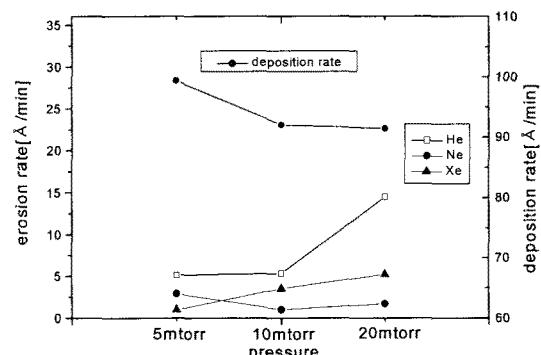


그림 4. 압력 변화에 따른 증착된 MgO의 deposition rate과 erosion rate

Fig. 4. Deposition rate and erosion rate of MgO  
vs. pressures

Power 500W, 온도 300°C, 바이어스 -50V의 magnetron sputter 증착 조건에서 압력을 5mtorr, 10mtorr, 20mtorr로 변화시켰을 때 증착된 MgO막으로 실험을 한 결과를 그림 4에 deposition rate과 erosion rate으로 나타냈다. He, Xe 가스에서는 압력이 5mtorr일 때 erosion rate이 가장 낮았으며 deposition rate이 증가할수록 erosion rate은 감소하는 경향이 나타났다. Ne 가스에서는 deposition rate이 크면 erosion rate도 크게 나타났다. 압력이 높아짐에 따라 평균 이동 거리(mean free path)가 짧아지므로 타겟을 출발한 입자 중에서 기판에 도달하는 입자의 비율이 작아지기 때문에 증착속도가 낮아진다. 그리고 내식각 특성은 저압에서 증착된 MgO막이 우수한 특성을 보이고 있다.

RIE 조건에서 내식각 실험을 분석해보면 대체적으로 Xe 가스에 대해 deposition rate이 증가 할수록 erosion rate은 감소하는 경향이 나타났다.

### 3. 결 론

실제 panel에서 MgO막의 erosion이 정량적으로 측정되지 못했으나 정성적인 MgO막의 erosion 측정 결과 MgO막은 수명에 큰 영향을 미치는 Xe 가스에 대해, 기판을 가열하지 않고, 자기 바이어스 전위가 -30V, 압력이 5mtorr의 조건으로 증착된 MgO막에서 erosion rate이 가장 낮았으며 일반적으로 deposition rate과 erosion rate이 반비례하는 경향이 나타났다.

### (참 고 문 헌)

- [1] 御子柴茂生, “プラズマディスプレイ最新技術”, ED リサーチ社, pp.19~20, 1996
- [2] K. Amano, “Characteristics of thick-film-printed MgO for a practical use in ac plasma displays”, SID'94 Digest, pp.323-326, 1994
- [3] Larry F. Weber, “Color plasma displays”, SID'95, Seminar lecture, pp.M-9/3~M-9/38, 1995.
- [4] Hiroshi Murakami, “Progress in HDTV PDP technologies at NHK”, Asia Display 98, workshop digest, pp.227-238, 1998
- [5] Mitsuhiro Kurashige, “The challenge of next-generation PDPs for the hi-vision PDP consortium in cooperation with the micro-discharge research Society established in 1997”, Asia Display 98, workshop digest, pp.223-226, 1998
- [6] 登尾雅之, 吉岡俊博, 佐野舞志雄, 布村惠史, “ac面放電型 プラズマディスプレイの放電劣化の検討”, 電子情報通信学会, pp.1-5, 1993
- [7] M.Noborio, T.Yoshioka, Y.Sano, and K.Nunomura, “(He,Ne)-Xe gas mixtures for high luminance color ac PDP”, SID 94 DIGEST, pp.727-730, 1994